

國立交通大學

工學院半導體材料與製程設備學程

碩士論文

鎳金屬誘發側向結晶複晶矽薄膜電晶體

— 界面狀態與低溫複晶矽薄膜電晶體特性之研究

**Ni-Metal Induced Lateral Crystallization of Polycrystalline Silicon Thin
Film Transistors**

— *Interface state and LTPS TFTs Device Performance*

研究生：趙育誠

指導教授：吳耀銓 教授

中華民國九十八年四月

鎳金屬誘發側向結晶複晶矽薄膜電晶體

— 界面狀態與低溫複晶矽薄膜電晶體特性之研究

**Ni-Metal Induced Lateral Crystallization of Polycrystalline
Silicon Thin Film Transistors**

— *Interface state and LTPS TFTs Device Performance*

研 究 生：趙育誠

Student : Yu-Cheng Chao

指 導 教 授：吳耀銓 博士

Advisor : Dr. Yewchung Sermon Wu

國 立 交 通 大 學

工學院半導體材料與製程設備學程

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Institute of Semiconductor Material and Process Equipment

College of Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

in

Program of Semiconductor Material and Process Equipment

April 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十八 年 四 月